【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成23年4月28日(2011.4.28)

【公表番号】特表2008-515511(P2008-515511A)
【公表日】平成20年5月15日(2008.5.15)
【年通号数】公開・登録公報2008-019
【出願番号】特願2007-535253(P2007-535253)
【国際特許分類】
Ａ６１Ｆ　2/44　(2006.01)
Ａ６１Ｃ　8/00　(2006.01)
Ａ６１Ｌ　27/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６１Ｆ　2/44
Ａ６１Ｃ　8/00　Ｚ
Ａ６１Ｌ　27/00　Ｍ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年3月3日(2011.3.3)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
ヒアルロン酸は、ヒドロキシル基の官能基化のための及び特にヒドロキシル基をアミン型ボンドで置換するための、当業界において知られた方法によって、ジメチルスルホキサイド（ｄｉｍｅｔｈｙｌｓｕｌｐｈｏｘｉｄｅ）又はそれと水との混合物，ジメチルフォルマミド（ｄｉｍｅｔｈｙｌｆｏｒｍａｍｉｄｅ）又はそれと水との混合物，Ｎ－メチルピロリドン（Ｎ－ｍｅｔｈｙｌ　ｐｙｒｏｌｉｄｏｎｅ）又はそれと水との混合物のような水溶液又は適切な溶媒液で、アミン層に結合させることができる。
［化２］Ｉａ１－ＯＨ＋Ｓｕｂ－ＮＨ$_2$－>Ｒ－ＮＨ－Ｒ´
上記式中で、Ｉａ１はヒアルロン酸の残渣であり、Ｓｕｂはアミン官能基を有する基質の残渣である。上述した内容から、本発明に係る方法が、採用される反応及び場合に応じて適用される反応条件に従ってヒアルロン酸の或る反応ヒロロキシル基のみならず、全ての反応ヒロドキシル基を官能基化させることができることを理解することができる。然しながら、ヒアルロン酸のヒドロキシル基の官能基化反応によって、アクロスティックＸＰＳ又はＥＳＣＡとして知られているＸ線光電子分光法によって数値が求められるように、０．６以上のフラクショナル被覆率（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）、即ち、ヒアルロン酸によって被覆された表面部分と結合したヒアルロン酸層の形成に帰着することが必要であり且つそれで十分である。その試験方法は、１９９８年に出版されたサーフェース　アンド　インターフェース　アナリイシス　マガジンの「ポリサッカライドが被覆された表面のＸＰＳ分析用の簡単なモデル」の２６，７４２－７４６でマルコ　モラとクララ　カッシネリとによって記述された記事の中で報告されている。